

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. März 2005 (03.03.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/019878 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G02B 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/007186

(22) Internationales Anmeldedatum:
2. Juli 2004 (02.07.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 35 215.5 1. August 2003 (01.08.2003) DE(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): CARL ZEISS SMT AG [DE/DE]: Carl-Zeiss-Str.
22, 73447 Oberkochen (DE).

(72) Erfinder; und

(73) Erfinder/Anmelder (nur für US): BIEG, Hermann
[DE/DE]: Faber du Faur Str. 2, 73433 Aalen (DE).

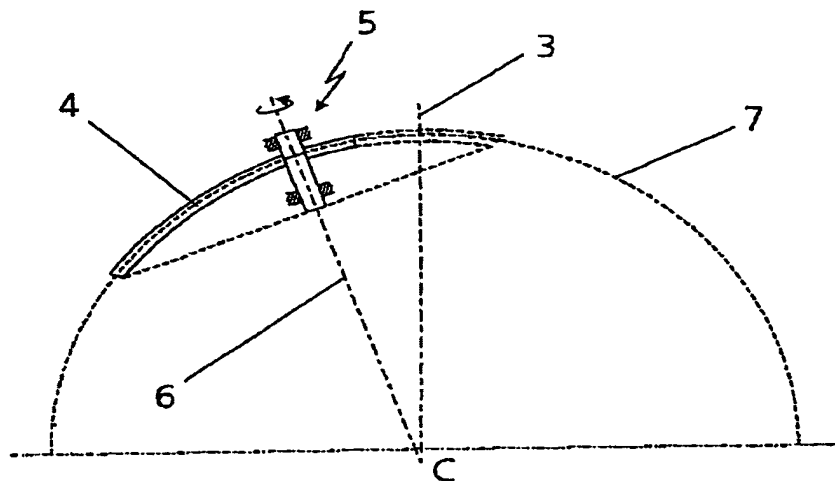
HUBER, Martin [CH/CH]; Bahnhofstr. 26, CH-5000
Aarau (CH). HENZELIN, François [CH/CH]; Rus des
Fontenantes 12, CH-2926 Boncourt (CH). BISCHOFF,
Thomas [DE/DE]; Adenauerstr. 4, 73433 Aalen (DE).
GELLRICH, Bernhard [DE/DE]; Schnaitbergstr. 3,
73434 Aalen (DE). SZEKELY, Gerhard [CH/CH]; Herb-
stweg 26, CH-8050 Zürich (CH). NGUYEN, Uy-Liem
[GB/CH]; Zeigweg 26, CH-5405 Baden (CH).

(74) Anwalt: LORENZ, Werner; Alte Ulmer Str. 2, 89522
Heidenheim (DE).(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(54) Title: OPTICAL IMAGING DEVICE COMPRISING AT LEAST ONE SYSTEM DIAPHRAGM

(54) Bezeichnung: OPTISCHE ABBILDUNGSVORRICHTUNG MIT WENIGSTENS EINER SYSTEMBLENDE



(57) Abstract: Disclosed is an optical imaging device (PL), particularly a lens for semiconductor lithography, comprising at least one system diaphragm (1, 1'). Said system diaphragm (1, 1') is provided with a plurality of movable lamellae (4, 4') that are rotatably mounted. The lamellae (4, 4') have a spherical curvature.

(57) Zusammenfassung: Eine optische Abbildungsvorrichtung (PL), insbesondere Objektiv für die Halbleiterlithographie, ist mit wenigstens einer Systemblende (1, 1') versehen. Die Systemblende (1, 1') weist eine Vielzahl von bewegbaren Lamellen (4, 4') auf, welche drehbar gelagert sind. Die Lamellen (4, 4') weisen eine sphärische Krümmung auf.

EV633201372

01/24/2006 TUE 05:42 [TX/RX NO 5420] 003

BEST AVAILABLE COPY